### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

## (43) 国際公開日 2005年8月11日(11.08.2005)

PCT

#### (10) 国際公開番号 WO 2005/074329 **A1**

(51) 国際特許分類7: H05B 33/22, C08G 61/12, H05B 33/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/001730

(22) 国際出願日:

2005年1月31日(31.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-025330 2004年2月2日(02.02.2004)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友化 学株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1048260 東京都中央区新川二丁 目27番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上谷 保則 (UE-TANI, Yasunori) [JP/JP]; 〒3050045 茨城県つくば市 梅園 2 - 1 3 - 1 - 2 - 3 0 1 Ibaraki (JP). 小熊 潤

天久保2-13-10-102 [baraki (JP). 安立 誠 (ANRYU, Makoto) [JP/JP]; 〒3050821 茨城県つくば市 春日2-40-1-201 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.); 〒5418550大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

にOまたは1を表し、O≦a+b≦1である。アリール基(A):アルキル基、アルコキシ基等から選ばれる置換 基を3個以上有するアリール基。複素環基(B):アルキル基、アルコキシ基等から選ばれる置換基を1個以上有 🖊 し、かつ該置換基の数と複素環のヘテロ原子の数の和が3以上である1価の複素環基)。

#### WO 2005/074329 A1

MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, 一 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

> 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。